

- Si consideri il reticolo in **Fig. 1**, dove $a = 1 \text{ nm}$. Si identifichi il tipo di reticolo, indicando una coppia di vettori primitivi, una cella primitiva e calcolando la densità atomica superficiale. Determinare quindi la tensione di accelerazione minima necessaria per osservare almeno un picco di diffrazione dai piani $\{110\}$ in un setup di diffrazione elettronica.
- In un setup di esperimento fotoelettrico in assenza di tensione applicata ($V_A = 0 \text{ V}$), gli elettroni fotogenerati incidono sull'anodo ad una velocità $v_a = 10^6 \text{ m/s}$. Nota la funzione lavoro del catodo $W = 4 \text{ eV}$, calcolare la lunghezza d'onda λ della radiazione incidente e la tensione V_{stop} al di sotto della quale non si osserva effetto fotoelettrico.
- Si consideri il sistema buca-barriera in **Fig. 2**, dove $a = 1 \text{ nm}$, $b = 2 \text{ nm}$, $V_0 = 5 \text{ eV}$. Usando l'approssimazione di buca a pareti infinite al solo fine del calcolo degli autostati della buca, si determini il campo F da applicare alla barriera affinché il tempo medio di tunneling per un elettrone sul primo livello confinato E_1 sia $t_{\text{TUN}} = 10 \text{ ns}$. Commentare qualitativamente come cambierebbe il risultato ottenuto se si considerasse l'altezza finita della barriera nel calcolo dell'autostato.
- Si consideri un oscillatore armonico $V(x) = \frac{1}{2} \alpha x^2$, con $\alpha = 2 \text{ eV/nm}^2$, e uno stato Ψ ottenuto come sovrapposizione paritaria del primo e terzo autostato, $\Psi = \frac{1}{\sqrt{2}}(\Psi_1 + \Psi_3)$. Calcolare la frequenza di oscillazione ω_{13} dello stato non-stazionario Ψ e tracciare qualitativamente il modulo quadro dell'autofunzione $|\Psi|^2$ ai tempi $t = 0$, $t = \pi/2\omega_{13}$, $t = \pi/\omega_{13}$, $t = 3\pi/2\omega_{13}$.
- Un elettrone in un cristallo di passo $a = 3 \text{ nm}$ è descritto da un'autofunzione $\psi_k(x) = u_k(x)e^{ikx}$. Sapendo che l'autofunzione torna in fase dopo 2 passi reticolari, determinare il valore del vettore d'onda cristallino k . Tracciare quindi il profilo della parte reale dell'autofunzione su 6 passi reticolari, sapendo che la funzione di Bloch è di tipo pari con un solo massimo in corrispondenza dell'atomo.
- Un semiconduttore 3D è descritto da una struttura a bande comprendente due bande di valenza ($m_{\text{LH}}^* = 0.2m_0$, $m_{\text{HH}}^* = 0.8m_0$), entrambe con apice in $k = 0$, e una banda di conduzione con minimo isotropo nel punto Γ ($m_{\Gamma}^* = 0.3m_0$). Determinare la massa DOS e di conduzione per lacune ed elettroni.
- Si consideri il materiale a gap indiretto in **Fig. 3**, dove $E_g = 1 \text{ eV}$, $k_0 = 2 \cdot 10^9 \text{ m}^{-1}$, $m_{\text{BC}}^* = 0.2m_0$ e $m_{\text{BV}}^* = 0.6m_0$. Determinare la minima energia di un fotone che possa essere assorbito in un processo a due particelle, e le velocità dell'elettrone e della lacuna appena dopo l'assorbimento del fotone.
- Un campione di cesio ($W_1 = 2.14 \text{ eV}$) alla temperatura $T_1 = 600 \text{ K}$ emette la stessa densità di corrente termoionica di un secondo campione di materiale ignoto alla temperatura $T_2 = 900 \text{ K}$. Dopo aver determinato la funzione lavoro W_2 del secondo materiale, si tracci il grafico di Arrhenius ($\log(J)$ in funzione di $1/kT$) per la densità di corrente J per i due materiali, facendo ragionevoli approssimazioni.
- Si consideri il campione di silicio drogato n sottoposto ad esperimento di effetto Hall in **Fig. 4** ($N_D = 10^{18} \text{ cm}^{-3}$, $t = 15 \text{ nm}$, $L = 10W = 10 \mu\text{m}$, $\mu_n = 1000 \text{ cm}^2\text{V}^{-1}\text{s}^{-1}$, $V_L = 2 \text{ V}$). Nota $V_H = 20 \text{ mV}$ con verso indicato in figura, determinare modulo e verso del campo magnetico B e della corrente I attraverso il dispositivo.
- Si consideri una barretta di silicio (droggaggio n, $N_D = 10^{18} \text{ cm}^{-3}$, tempo di ricombinazione dei minoritari $\tau_p = 100 \text{ ns}$) dove un fascio laser impone una concentrazione in eccesso di portatori minoritari in superficie pari a $\delta p(0) = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$. Nota la mobilità delle lacune $\mu_p = 400 \text{ cm}^2\text{V}^{-1}\text{s}^{-1}$, determinare la distanza x_{fe} dalla superficie oltre la quale il semiconduttore si può considerare all'equilibrio termodinamico.

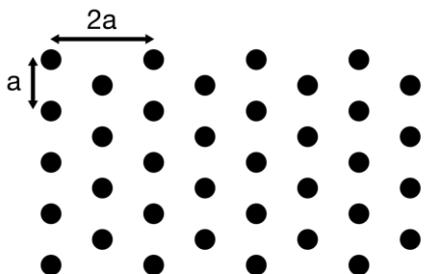


Fig. 1

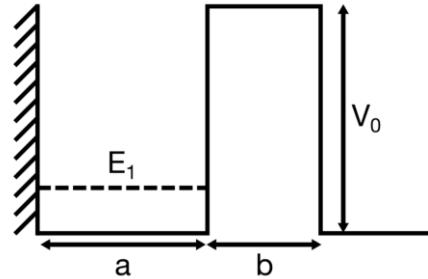


Fig. 2

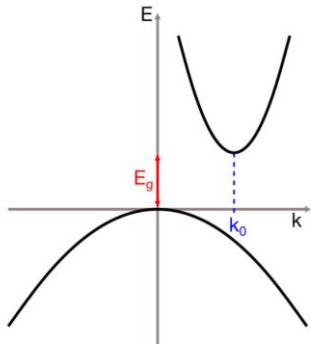


Fig. 3

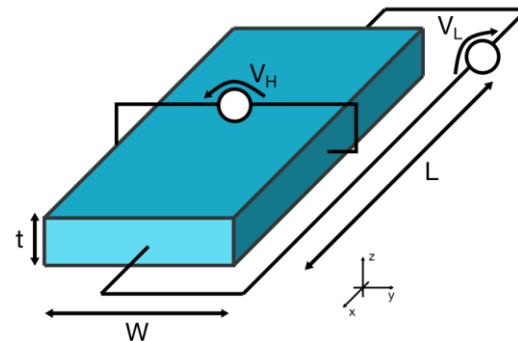


Fig. 4

- Consider the lattice in **Fig. 1**, where $a = 1 \text{ nm}$. Determine the lattice type, denoting a pair of primitive vectors, a primitive cell, and calculating the surface atomic density. Then, calculate the minimum acceleration voltage required to observe at least one diffraction peak from $\{110\}$ planes in an electron diffraction setup.
- In a photoelectric experiment setup, in absence of applied voltage ($V_A = 0 \text{ V}$), the photogenerated electrons imping on the anode at a velocity $v_a = 10^6 \text{ m/s}$. Given the cathode work-function $W = 4 \text{ eV}$, calculate the wavelength λ of the impinging radiation and the voltage V_{stop} below which no photoelectric effect is observed.
- Consider the well-barrier system in **Fig. 2**, where $a = 1 \text{ nm}$, $b = 2 \text{ nm}$, $V_0 = 5 \text{ eV}$. Using the infinite-wall approximation for the sole purpose of well eigenstates computation, determine the field F that must be applied to the barrier for the mean tunneling time for an electron on the first confined energy level E_1 to be $t_{\text{TUN}} = 10 \text{ ns}$. Qualitatively, comment on how the obtained result would change if the finite height of the barrier were considered in the computation of the eigenstate.
- Consider a harmonic oscillator $V(x) = \frac{1}{2} \alpha x^2$, with $\alpha = 2 \text{ eV/nm}^2$, and a state Ψ obtained as an equal superposition of the first and third eigenstate, $\Psi = \frac{1}{\sqrt{2}}(\Psi_1 + \Psi_3)$. Calculate the oscillation frequency ω_{13} of the non-stationary state Ψ and qualitatively plot the modulus squared of the eigenfunction $|\Psi|^2$ for times $t = 0, t = \pi/2\omega_{13}, t = \pi/\omega_{13}, t = 3\pi/2\omega_{13}$.
- An electron in a crystal with lattice step $a = 3 \text{ nm}$ is described by an eigenfunction $\psi_k(x) = u_k(x)e^{ikx}$. Knowing that the eigenfunction goes back in phase after 2 lattice steps, determine the value of the crystalline wave vector k . Plot the real part of the eigenfunction on 6 lattice steps, knowing that the Bloch function is even with one maximum in correspondence of the atom.
- A 3D semiconductor is described by a band structure comprising two valence bands ($m^*_{\text{LH}} = 0.2m_0, m^*_{\text{HH}} = 0.8m_0$), both with apex in $k = 0$, and one conduction band with isotropic minimum in the Γ point ($m^*_{\text{r}} = 0.3m_0$). Determine the DOS and conduction mass for holes and electrons.
- Consider the indirect gap material in **Fig. 3**, where $E_g = 1 \text{ eV}$, $k_0 = 2 \cdot 10^9 \text{ m}^{-1}$, $m^*_{\text{BC}} = 0.2m_0$ e $m^*_{\text{BV}} = 0.6m_0$. Determine the minimum energy of a photon that can be absorbed in a two-particle process, and the velocities of the electron and hole right after the photon absorption.
- A caesium sample ($W_1 = 2.14 \text{ eV}$) at temperature $T_1 = 600 \text{ K}$ emits the same thermionic current density of a second sample of unknown material at temperature $T_2 = 900 \text{ K}$. After determining the work function W_2 of the second material, draw the Arrhenius plot ($\log(J)$ as a function of $1/kT$) for the current density J for both materials, under reasonable assumptions.
- Consider the n-doped silicon sample undergoing a Hall effect experiment in **Fig. 4** ($N_D = 10^{18} \text{ cm}^{-3}$, $t = 15 \text{ nm}$, $L = 10W = 10 \mu\text{m}$, $\mu_n = 1000 \text{ cm}^2\text{V}^{-1}\text{s}^{-1}$, $V_L = 2 \text{ V}$). Given $V_H = 20 \text{ mV}$ oriented as denoted in the figure, determine modulus and orientation of the magnetic field B and of the current I across the device.
- Consider a silicon slab (n-doping, $N_D = 10^{18} \text{ cm}^{-3}$, minority carrier recombination time $\tau_p = 100 \text{ ns}$) where a laser beam imposes an excess minority carrier concentration at the surface $\delta p(0) = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$. Given the hole mobility $\mu_p = 400 \text{ cm}^2\text{V}^{-1}\text{s}^{-1}$, determine the distance x_{fe} from the surface after which the semiconductor can be considered at thermodynamic equilibrium.

Costanti fisiche:

massa dell'elettrone
costante di Planck
carica elettronica
costante di Boltzmann
velocità della luce
costante dielettrica nel vuoto
costante di Stefan-Boltzmann
costante di Wien

$m_0 = 9.109 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
 $h = 6.626 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$
 $e = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
 $k_B = 1.381 \cdot 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$
 $c = 2.998 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$
 $\epsilon_0 = 8.85419 \cdot 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$
 $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$
 $C_W = 2.8 \cdot 10^{-3} \text{ K m}$

costante dielettrica relativa ϵ_r
concentrazione intrinseca n_i [cm^{-3}]
gap di energia E_g [eV]
densità di stati effettiva in banda di conduzione N_c [cm^{-3}]
densità di stati effettiva in banda di valenza N_v [cm^{-3}]

Si	Ge
11.7	16
1.45×10^{10}	2.4×10^{13}
1.12	0.66
2.8×10^{19}	1.04×10^{19}
1.04×10^{19}	0.6×10^{19}